(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-288331

(43)公開日 平成4年(1992)10月13日

 (51) Int.Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 0 8 G 73/10
 NTF
 9285-4 J

 C 0 8 L 79/08
 LRE
 9285-4 J

 G 0 2 B 1/04
 7132-2 K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21) 出願番号	特願平3-52833	(71) 出願人 000004226
(2-) [14)(15)		日本電信電話株式会社
(22) 出願日	平成3年(1991)3月18日	東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
		(72)発明者 安藤 慎治
		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
		本電信電話株式会社内
		(72)発明者 松浦 徹
		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
		本電信電話株式会社内
		(72)発明者 佐々木 重邦
		東京都千代田区内幸町一丁月1番6号 口
		本電信電話株式会社内
	•	(74)代理人 介理士 志賀 正武
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ポリイミド光学材料

(57)【要約】

【目的】 極めて低い複屈折を有し、かつこれを制御でき、光部品、光電子部品に適用可能なポリイミド光学材料を得る。

【構成】 一般式〔I〕

【化1】

(式中R、は4価の有機基、R、はイミド環の窒素原子に結合するペンゼン環を含む2価の有機基を示す)で表わされる繰返し単位を有するポリイミド、ポリイミド共重合体、ポリイミド混合物からなり、この繰り返し単位のイミド環の窒素原子に結合したペンゼン環のオルト位の双方に、ハロゲン原了または1価の有機基を導入する。これにより、イミド環と隣接するペンゼン環をより直交に近い構造とし、両環の面方向が分子鎖全体として平均化され複屈折が低減する。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 下記一般式〔I〕

[化1]

(式中R1 は4価の有機基、R2 はイミド環の窒素原子 に結合するペンゼン環を含む2価の有機基を示す)で表 わされる繰り返し単位を有するポリイミド、ポリイミド 共重合体、ポリイミド混合物を用いるポリイミド光学材 料であって、イミド環の窒素原子に結合したベンゼン環 のオルト位の双方に、ハロゲン原子または1価の有機基 を導入したことを特徴とするポリイミド光学材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は特に、光電子部品などに 用いられる複屈折の極めて小さく、かつその値を制御し うるポリイミド光学材料に関する。

[0002]

【従来の技術】有機高分子材料(プラスチック)は、無 機系材料に比べて軽量であり、耐衝撃性、加工性に優 れ、取扱いが容易であるなどの特長を有しているため、 これまでも光ファイパーや光ディスク用基盤、光学用レ ンズなど様々な光学用途に用いられてきた。さらに近 年、光通信システムの実用化に伴い、種々の光導波技術 の確立が望まれていることを受けて、光回路あるいは光 電子回路の導波路用部品として用いることのできるブラ スチック光学材料が提案されている(例えば特願平2-317913号)。中でもフッ素原子を分子構造中に導 入した含フッ素芳香族ポリイミドは、良好な光学特性 (透明性) とともに高い耐熱性、低い吸水率など、光部 品に求められる多くの特性を満足することが知られてお り(例えば特願平2-110500号)、次世代のプラ スチック光学材料として現在最も有望視されている。

【0003】ところでこのポリイミドや光ディスク基板 に利用されているポリカーポネートのように分子構造内 にペンゼン環や複素環を有するプラスチックは、これら の環構造が本来的に有する分極率の異方性により、しば 40 しば屈折率の異方性すなわち複屈折を示すことが知られ ている。一方、プラスチック材料を光導波路部品に適用 する場合、各々の導波路構造に適合した導波条件を満足 するためには屈折率の精密な制御を必要とする。

【0004】特に光回路、光電子回路内ではシングルモ ードと呼ばれる条件を満たすためにコア部とクラッド部 の屈折率を10つ以下の精度で制御することが不可欠で あり、また光の偏波面を一定に保つ偏波保存型導波路で は縦方向と横方向の屈折率差(複屈折)を10-3程度の が存在すると、屈折率の精密制御を困難にするばかり か、導波路設計が非常に複雑なものになる。ことに、薄 膜あるいは光導波路において問題となるのは面内方向の 複屈折(光が導波する方向の違いによる屈折率差)より も、面内と面に垂直な方向との複屈折(光の偏波面が面 内と面に垂直な方向で生ずる屈折率差) であるので、こ

の複屈折を低減そして制御する技術がプラスチック光導

波路を開発する上でのキーテクノロジーとなる。

【0005】すでに実用化されつつある石英系光導波路 10 においてはこの複屈折を5×10-1程度に抑えることが **可能となっており、また前述のポリカーポネートによる** 光ディスクでも熱成形時の条件を最適化することによっ て複屈折の小さなものが得られている。 しかしポリイミ ドはガラス転移点以下で熱分解が始まる場合が多いた め、熱処理による複屈折の制御は困難である。ポリイミ ドフィルムの複屈折についてはすでにいくつかの報告例 があり [例えばT. P. ラッセル(T. P. Russe 1, ジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス (ポリマー フィジックス) 、第21巻、第1745頁 (1983 20 年) 参照)]、従来のポリイミドで8×10-2、複屈折 の小さな含フッ素ポリイミドでも最低値で3. 4×10 -*の複屈折が存在することが知られており、このままで は精密光部品や光電子部品に適用することができない。 しかも、1×10-3以下の複屈折を示すポリイミド光学 材料はいまだ得られておらず、ポリイミド光学材料を用 いた溥膜や光導波路においてその複屈折を制御した例も 知られていない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このようにポリイミド 光学材料を光部品、光電子部品に適用するにあたって は、まず復屈折の非常に小さなポリイミド光学材料の開 発、ついでこの複屈折を制御する技術の開発が不可欠で ある。本発明はこのような現状にかんがみてなされたも のであり、その目的は複屈折が非常に小さなポリイミド 光学材料、および複屈折を制御しうるようにしたポリイ ミド光学材料を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明はポリイミド光学材料の複屈折低減および複屈折制 御に関するものであって、下記一般式〔1〕:

【化2】

(式中Ri は4価の有機基、Ri はイミド環の窒素原子 に結合するペンゼン環を含む2価の有機基を示す)で表 わされる繰り返し単位を有するポリイミド、ポリイミド 一定値にしなくてはならない。光学材料に大きな複屈折 50 共重合体、ポリイミド混合物を用いるポリイミド光学材

料であって、イミド環の窒素原子に結合したベンゼン環のオルト位の双方に、ハロゲン原子または1 価の有機基を導入したことを特徴とする。

【0008】本発明者らは、種々の既存のプラスチック 光学材料についてその複屈折を測定し、またこれまでの 報告例を参照することによって、プラスチック光学材料 における複屈折の原因について鋭意検討した。その結 果、複屈折を引き起こす原因の第一は、試料の熱成形時 あるいは薄膜形成時に起こる、屈折率異方性の大きな官 能基、つまり芳香族環、複素環、カルポニル基、シアノ 基などの配向によることが明らかとなった。特に芳香族 ポリイミドは分子内にベンゼン環とイミド環の双方を有 するため、これらの環構造の多くが薄膜形成時に同一面 を持って配向すると、結果として大きな複屈折を示すこ とになる。中でも問題となるのは、イミド環とその窒素 に結合しているペンゼン環の相互回転状態であって、た とえば以下の構造式 [II] に示す代表的なポリイミドに おいて、この2つの環構造が同一平面をとると、必然的 に5つの環境造が同一平面上に存在することになる。

[化3]

一方、この2つの環構造が相互にねじれた配向をとる場合には、ペンゼン環およびイミド環の面方向が分子鎖全体として平均化され、結果として復屈折が低減されるものと予測される。

[0010] そこで本発明者らは、以上の考察に立ちポリイミド光学材料の複屈折を低減するためには、イミド エニルスルホン、2,2ーピス(3,4ージカルポキシ フェニル)プロパン、2,2ーピス(3,4ージカルポ ヤシフェニル)プロパン、2,2ーピス(3,4ージカルポ ヤシフェニル) ペキサフルオロプロパン、5,5′ーピって立体障害を生じせしめ(構造式(III)参照)、イス(トリフルオロメチル) -3,3′,4,4′ーテトラカルポキシジフェニル。2,2′,5,5′ーテトラることが複屈折の低減に有効であろうと予測するにいた50 キス(トリフルオロメチル) -3,3′,4,4′ーテ

った。 【化4】

(式中XおよびYはハロゲン原子あるいは1価の有機基を示す)この予測を理論的に裏づけるため、2種のモデル化合物について分子力場法(MMP2法)による回転 10 エネルギーの計算を行った結果を図1及び図2に示す。前記構造式[III]におけるX、Yがともに水素である従来のポリイミドのモデル(図1)ではエネルギーが全回転角で平均化されており、かつイミド環と隣接ベンゼン環が直交する場合の立体エネルギーは平面構造のそれと同程度なのに対し、X、Yがともにフッ素の場合(図2)には平面構造が大きく不安定化されて、イミド環と隣接ベンゼン環が直交する状態に近くなることが計算から明瞭に示される。

[0011]よって本発明におけるポリイミド光学材料 20 は、ポリイミドの繰り返し単位中にあらわれる前記構造式 [III]の部分において、イミド環に隣接するベンゼン基のイミド環側の部位(XとY)の双方に、ハロゲン原子あるいは1価の有機基が結合していることをその本質とする。これによりポリイミドの立体化学構造が制御され、ポリイミド光学材料の複屈折を低減または制御することが可能となるのである。

【0012】本発明のポリイミド光学材料を製造するに あたって使用するテトラカルポン酸またはその誘導体と しての酸無水物、酸塩化物、エステル化物としては次の ようなものがあげられる。ここではテトラカルボン酸と しての例をあげる。ピロメリット酸、(トリフルオロメ チル)ピロメリット酸、ジ(トリフルオロメチル)ピロ メリット酸、ジ(ヘプタフルオロプロピル)ピロメリッ ト酸、ペンタフルオロエチルピロメリット酸、ピス (3, 5-ジ (トリフルオロメチル) フェノキシ) ピロ メリット酸、2,3,3',4'-ピフェニルテトラカ ルポン酸、3,3',4,4'-テトラカルポキシジフ ェニルエーテル、2,3',3,4'ーテトラカルボキ シジフェニルエーテル、3,3',4,4'-ペンゾフ ェノンテトラカルポン酸、2,3,6,7-テトラカル ポキシナフタレン、1, 4, 5, 7ーテトラカルボキシ ナフタレン、1, 4, 5, 6-テトラカルポキシナフタ レン、3、3′、4、4′ーテトラカルポキシジフェニ ルメタン、3,3',4,4'-テトラカルポキシジフ ェニルスルホン、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシ フェニル) プロパン、2, 2-ビス(3, 4-ジカルポ キシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、5,5'-ピ ス (トリフルオロメチル) -3,3',4,4'-テト ラカルポキシジフェニル、2,2',5,5'-テトラ

トラカルボキシビフェニル、5, 5' – ビス(トリフルオロメチル) – 3, 3', 4, 4' – テトラカルボキシビフェニルエーテル、

[0013] 5, 5'-ピス(トリフルオロメチル)-3, 3′, 4, 4′ーテトラカルポキシペンゾフェノ ン、ビス { (トリフルオロメチル) ジカルボキシフェノ キシ} ペンゼン、ピス ((トリフルオロメチル) ジカル ポキシフェノキシ》 (トリフルオロメチル) ペンゼン、 ビス(ジカルポキシフェノキシ)(トリフルオロメチ ル) ペンゼン、ヒス (ジカルボキシフェノキシ) ピス 10 (トリフルオロメチル) ベンゼン、ピス (ジカルポキシ フェノキシ) テトラキス (トリフルオロメチル) ベンゼ ン、3,4,9,10-テトラカルボキシペリレン、 2, 2-ピス {4-(3,4-ジカルボキシフェノキ シ) フェニル) プロパン、プタンテトラカルボン酸、シ クロペンタンテトラカルポン酸、2,2-ピス【4-(3, 4-ジカルポキシフェノキシ) フェニル ヘキサ フルオロプロパン、ピス{(トリフルオロメチル)ジカ ルポキシフェノキシ} ピフェニル、ピス { (トリフルオ ロメチル) ジカルポキシフェノキシ} ビス (トリフルオ 20 ロメチル)ピフェニル、ピス{(トリフルオロメチル) ジカルポキシフェノキシ} ジフェニルエーテル、ピス (ジカルボキシフェノキシ) ピス (トリフルオロメテ ル) ピフェニルなどである。

【0014】またジアミンとしては、2つのアミノ基か ら見たオルト位の双方にハロゲン原子または1価の有機 基が結合しているものならどのようなものでもよいが、 前述のようにフッ素化物を用いると光透過性、耐熱性、 吸水性、誘電率などが改善されるため、含フッ素ジアミ ンを用いることが望ましい。以下、この目的に合ったジ アミンを例示すると、テトラフルオローpーフェニレン ジアミン、テトラフルオローm-フェニレンジアミン、 テトラメチルーローフェニレンジアミン、テトラメチル ーm-フェニレンジアミン、テトラ(トリフルオロメチ ル) - p - フェニレンジアミン、テトラ(トリフルオロ メチル) -m-フェニレンジアミン、3,3',5, 5′-テトラフルオロペンジジン、3,3′,5,5′ ーテトラフルオロー4、4′ージアミノジフェニルエー テル、3, 3′, 5, 5′ーテトラフルオロー4, 4′ ージアミノジフェニルメタン、3,3',5,5'ーテ 40トラメチルベンジジン、3,3',5,5'ーテトラメ チルー4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3, 3', 5, 5'ーテトラメチルー4, 4'ージアミノジ フェニルメタン、3, 3′, 5, 5′-テトラ(トリフ ルオロメチル) -4, 4′-ジアミノジフェニル、3, 3', 5, 5'-テトラ (トリフルオロメチル)-4, 4′-ジアミノジフェニルエーテル,

ジアミノジフェニルエーテル、オクタフルオロー4, 4'ージアミノジフェニルメタン、オクタメチルベンジジン、オクタメチルー4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、オクタメチルー4, 4'ージアミノジフェニルメタン、オクタ(トリフルオロメチル)ー4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、オクタ(トリフルオロメチル)ー4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、オクタ(トリフルオロメチル)ー4, 4'ージアミノジフェニルメタンなどである。

6

【0016】本発明に使用するポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の製造方法は、通常のポリアミド酸の製造条件と同じでよく、一般的にはN-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミドなどの極性有機溶媒中で反応させる。本発明においてはジアミンまたテトラカルボン酸二無水物とも単一化合物で用いるばかりではなく、複数のジアミン、テトラカルボン酸二無水物を混合して用いる場合がある。その場合は、複数または単一のジアミンのモル数の合計と複数または単一のテトラカルボン酸二無水物のモル数の合計が等しいかほば等しくなるようにする。前述のポリアミド酸などの重合溶液において、その溶液の濃度は5~40重量%、好ましくは10~25重量%であり、また前記ポリマー溶液の回転粘度(25℃)は50~5000ポアズであることが好適である。

[0017] 本発明のポリイミド光学材料のフィルム製造法としては、通常のポリイミドフィルムの製造法が使用できる。例えば、ポリアミド酸溶液をアルミ板上にスピンコートし、窒素雰囲気下で70℃から350℃まで段階的に加熱(70℃ 2時間、160℃ 1時間、250℃ 30分、350℃ 1時間)し固化する。その後、このアルミ板を10%塩酸等の酸水溶液に浸しアルミ板を溶解してポリイミド光学材料のフィルムを得ることができる。

【0018】また、本発明では、ポリイミド光学材料の 複屈折を制御するには、複数のジアミンをテトラカルポ ン酸と共重合する方法や複数のジアミンを用いて複数の ポリアミド酸を得、これらを混合する方法などがある。 これによって複屈折を極めて低いレベルで、しかも所定 の値に制御することができる。

[0019]

【実施例】以下、実施例により本発明のポリイミド光学材料について詳細に説明する。なお下記各例中、イミド化の確認は赤外吸収スペクトルにおけるカルポニル基の対称および非対称伸縮振動による特性吸収から行った。ポリイミドフィルムの複屈折は偏光子を取り付けたアッペ屈折計(測定波長;589.3nm、測定温度;23℃)により、フィルム面内及びフィルム厚さ方向の屈折率を測定し、その差をとることにより求めた。なお以下に示す実施例において、フィルム面内の複屈折はいずれも1×10・以下であった。測定に供したポリイミドフィルムの順原は10μmから20μmの範囲であり、複

屈折の測定値は膜厚によらなかった。

【0020】 実施例1

三角フラスコに2、2′ーピス(3,4-ジカルポキシ フェニル) - ヘキサフルオロプロパン二無水物(6 FD A) 8, 885g(0, 02mol)と、以下の構造で示 されるテトラフルオローローフェニレンジアミン(FP P)

【化5]

$$H_2N \longrightarrow F F NH_2$$

3.60g(0.02mol)、及びN-メチルー2-ピ ロリドン (NMP) 100gを加え、この混合物を窒素 雰囲気下、室温で3日間攪拌しポリアミド酸のNMP溶 液を得た。これをアルミ板上にスピンコートし、窒素雰 囲気下70℃で2時間、160℃で1時間、250℃で 30分間、更に350℃で1時間加熱して完全にイミド 化を行った。このアルミ板を10%HC1溶液に浸して 20 溶解させポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフ ィルムの複屈折を測定したところ0.0018であっ た。

[0021] 実施例2

実施例1におけるFPPの代わりに、以下の構造式で示 されるテトラフルオローmーフェニレンジアミン(FM P)

[化6]

3. 60g (0. 02 mol) に置き換えて実施例1と同 様に合成し、同様の熱処理を行ってポリイミドフィルム を得た。このフィルムの復屈折を測定したところ0.0 008であった。

【0022】実施例3

実施例1におけるFPPの代わりに、以下の構造式で示 されるテトラメチル-p-フェニレンジアミン (MM 40 · P) .

【化7】

3. 28g(0.02mol)に置き換えて実施例1と同 様に合成し、同様の熱処理を行ってポリイミドフィルム を得た。このフィルムの複屈折を測定したところ0.050(0.02mol)に置き換えて実施例と同様に合成し、

016であった。

【0023】 実施例4~6

実施例1~3における6FDAの代わりに、ピロメリッ ト二酸無水物 (PMDA) 4.36g (0.02mol) に置き換えて実施例1と同様に合成し、同様の熱処理を 行ってポリイミドフィルムを得た。実施例1~3とあわ せ、測定された複屈折を表1にまとめる。

8

【0021】 実施例7

実施例1におけるFPPの代わりに、FPP1.80g 10 (0.01mol) \(\text{MPP1.80g(0.01mol)}\) を混合したものに置き換えて実施例1と同様に合成し、 同様の熱処理を行って2種のジアミンからなる共重合ポ リイミドフィルムを得た。このフィルムの復屈折を測定 したところ0、0013であった。

【0025】 実施例8

実施例1により得られた6FDAとFPPのポリアミド 酸のNMP溶液と実施例2により得られた6FDAとF MPのポリアミド酸のNMP溶液を等量正確に計りと り、室温で1時間攪拌した。このNMP溶液に同様の熱 処理を行って2種のポリイミド混合物からなるフィルム を得た。このフィルムの複屈折を測定したところ0.0 014であった。

【0026】比較例1

実施例1におけるFPPのかわりに、以下の構造式で示 される 4、 4′ -ジアミノジフェニルエーテル (OD A)

[化8]

30 4.00g(0.02mol)に置き換えて実施例1と同 様に合成し、同様の熱処理を行ってポリイミドフィルム を得た。このフィルムの複屈折を測定したところ0.0 080であった。

[0027] 比較例2

実施例1におけるFPPのかわりに、以下の構造式で示 される2, 2′-ピス (トリフルオロメチル) -4. 4'-ジアミノピフェニル(TFDB)

【化9】

6. 40g(0,02mol)に置き換えて実施例1と同 様に合成し、同様の熱処理を行ってポリイミドフィルム を得た。このフィルムの複屈折を測定したところ0.0 057であった。

[0028] 比較例3,4

比較例1, 2における6FDAをPMDA4. 36g

9

*【0029】 【表1】

同様の熱処理を行ってポリイミドスフィルムを得た。 測定された複屈折を比較例 1, 2 とあわせ表 2 にまとめる。

実施例	酸無水物	ジアミン	複屈折(×10 ⁻³)
実施例 1	BFDA	FPP	1.8
実施例 2	8 F D A	FMP	0.8
実施例 3	8 F D A	MPP	1.6
実施例 4	PMDA	FPP	2 4
実施例 5	PMDA	FMP	1.5
実施例 6	PMDA	MPP	2 1
実施例 7	8 F D A	FPP FMP	1.3
実施例 8	6 F D A	FPP FMP	1.4

[0030]

【表2】

比較例	酸無水物	ジアミン	複屈折(×10⁻³)
比較例 1	SFDA	ODA	8.0
比較例 2	8 F D A	TFDB	5.7
比較例 3	PMDA	ODA	7 5
比較例 4	PMDA	TFDB	137

【0031】表1および表2における略号は、以下の通 りである。

6 F D A ··· 2 , 2 ' ーピス (3 , 4 ージカルボキシフェニル) ーヘキサフルオロプロパン二無水物

PMDA…ピロメリット二酸無水物

FFP…テトラフルオローpーフェニレンジアミン
FMP…テトラフルオローmーフェニレンジアミン
MMP…テトラメチルーpーフェニレンジアミン
ODA…4, 4'ージアミノジフェニルエーテル
TFDB…2, 2'ーピス(トリフルオロメチル)ー
4, 4'ージアミノピフェニル

【0032】以上の結果から明らかなように、同じ酸無水物からポリイミドフィルムを作製した場合、本発明で示したジアミンを用いることにより複屈折の値は大きく低減する。特に実施例2で示したポリイミドフィルムの複屈折は、これまでに知られている最低値の1/4以下でありかつ10-3以下の値を示して本発明の有効性を支持している。また複数のジアミンを共重合あるいはポリ

アミド酸の段階で混合することにより、復屈折を制御することが可能であることが確認された。

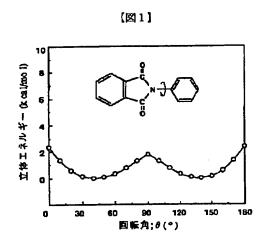
[0033]

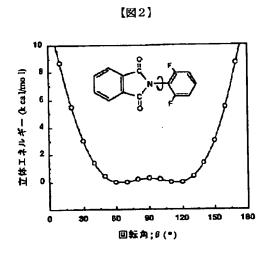
【発明の効果】以上説明したように、本発明のポリイミド光学材料は、前記一般式 [1] で表わされる繰り返し単位を有するポリイミド、ポリイミド共富合体、ポリイミド混合物を用いるポリイミド光学材料であって、イミド環の窒素原子に結合したペンゼン環のオルト位の双方に、ハロゲン原子または1価の有機基を導入したものであるので、複屈折が極めて低く、かつその値を制御しうるポリイミド光学材料が得られ、光部品、光電子部品に好適なものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来のポリイミドのモデル化合物における立体 エネルギーの計算結果である。

[図2] 本発明によるポリイミド光学材料のモデル化合物における立体エネルギーの計算結果である。





フロントページの続き

(72)発明者 山本 二三男 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内